

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2007 年 1 月 11 日 (11.01.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/004345 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/085 (2006.01) *C08K 5/544* (2006.01)
G03F 7/075 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/308093
- (22) 国際出願日: 2006 年 4 月 18 日 (18.04.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2005-191346 2005 年 6 月 30 日 (30.06.2005) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 弓場 智之 (YUBA, Tomoyuki) [JP/JP]; 〒6008212 京都府京都市下京区塩小路町 5 2 4 - 1 Kyoto (JP). 藤田 陽二 (FUJITA, Yoji) [JP/JP]; 〒5200846 滋賀県大津市富士見台 3 8 - 5 2 Shiga (JP). 富川 真佐夫 (TOMIKAWA, Masao) [JP/JP]; 〒5200865 滋賀県大津市南郷 2 - 3 4 - 7 Shiga (JP).
- (74) 代理人: 岩見 知典 (IWAMI, Tomonori); 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社知的財産部内 Shiga (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION AND ADHESION ENHANCER

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物および接着改良剤

(57) Abstract: A photosensitive resin composition comprising alkali soluble resin (a), silicon compound (b) having secondary aromatic amino and alkoxy and at least one member (c) selected from among a photopolymerization initiator, a photoacid generator and a photobase generator. Thus, there can be obtained a photosensitive resin composition that without detriment to the storage stability of solution, strikingly enhances the adhesion with substrate after curing and even at development, is free from micropattern peeling.

(57) 要約: 本発明は、(a) アルカリ可溶樹脂、(b) 2 級の芳香族アミノ基およびアルコキシ基を有するケイ素化合物、および(c) 光重合開始剤、光酸発生剤および光塩基発生剤から選ばれた少なくとも 1 つを含む感光性樹脂組成物である。本発明によれば、溶液の保存安定性を損なうことなく、キュア後の基板との接着性を著しく高めるとともに、現像時にも微細パターンが剥がれないような感光性樹脂組成物を得ることができる。



WO 2007/004345 A1